

2022年4月26日

プレアナウンス ワークショップ NGL2022

応用物理学会次世代リソグラフィ（NGL）技術研究会では、今年も NGL ワークショップ（ワークショップ NGL2022）を開催する予定です。本年も多くの方々に参加していただきたく、下記に概要をお知らせいたします。5月中には詳細プログラムとともに再度ご案内いたします。ぜひ参加をご検討ください。

応用物理学会 次世代リソグラフィ研究会
幹事長 古澤 孝弘

記

会期：2022年7月7日（木）、8日（金）
会場：Zoom によるオンライン開催（リアルタイム発表）

プログラム概要：

基調講演：

- “Semiconductor Industries: Creating the opportunities for the bright future in Japan”
東 哲郎氏（TIA, TEL）
- “Mask Technologies for EUVL”
Ted Liang 氏（intel）
- “The present and the future of EUVL”
Jos Benschop 氏（ASML）

国際光工学会 SPIE 2022 年度ルドルフ & ヒルダ・キングスレイク光学設計賞
(SPIE Rudolf and Hilda Kingslake Award in Optical Design)受賞記念講演会
渋谷 真人先生（東京工芸大学）

技術セッション：

- 7/7 光リソグラフィ & アドバンスドパターニング、レジスト材料、ポスターセッション
7/8 ナノインプリント、EB・計測・マスク技術、EUVL

主催： 応用物理学会 次世代リソグラフィ技術研究会（分科会）

協賛： 応用物理学会 シリコンテクノロジー分科会

NGL2022 企画運営委員会：

委員長：古澤 孝弘 副委員長：岡崎 信次

委員：備前 大輔、井谷 俊郎、宮本 恭幸、中川 勝、石原 直、松井 真二、堀内 敏行、
渋谷 真人、田川 精一、落合 幸徳、老泉 博昭、笑喜 勉、酒井 啓太、小林 幸子、
尹 成圓、鈴木章義、松山知行、引地龍吾、伊藤高臣、藤井 清、金口時久、原田 哲男

事務局：相良好美

〒335-0021 埼玉県戸田市新曾 45

TEL：090(5493)1147

FAX：048(443)4204

E-mail：ngl@jsap.or.jp

参加費※：税込み（消費税課税）表示

主催・協賛団体会員、学生：	1,500円（6月14日以前の申し込み）
	2,000円（6月15日以降の申し込み）
一般：	9,000円（6月14日以前の申し込み）
	10,000円（6月15日以降の申し込み）

※申し込み後、7月1日までに銀行振り込み等でお支払いください。

申し込み方法：5月上旬に申し込み専用ホームページを開設する予定です。詳細はNGL研究会のホームページ（<http://annex.jsap.or.jp/NGL/>）に掲載する予定です。

応用物理学会次世代リソグラフィ技術研究会は、本ワークショップの他、年に3回程度、会員が無料で参加できる定例研究会を開催しております。当研究会には、法人（賛助）会員、個人会員としての入会が可能です。ご興味のある方は上記事務局までご連絡ください。

以上